

キオクシア株式会社から横浜市内への研究所新設に係る 企業立地促進条例の認定申請書が提出されました。 ～市内再投資の支援対象エリア拡大後の申請第一号～

横浜市では、本社・研究所・工場などの新規立地に向け、積極的な企業誘致に取り組んでいます。

このたび、半導体メモリ大手のキオクシア株式会社代表取締役社長の早坂伸夫様が山中竹春横浜市長を訪問され、研究所の新設について、本市の企業立地支援制度である「企業立地促進条例」に基づく認定申請書を提出されました。

企業立地促進条例は、市内に事業所を持つ企業の再投資（拠点集約、設備増強等）について対象エリアを一部の地域に限っていましたが、本年4月から市内全域に拡大しており、同社の計画が地域拡大に伴う申請の第一号となります。



(写真左より) 代表取締役社長 早坂様、山中市長



(写真左より) 横浜テクノロジーキャンパス所長 小林様、
山中市長、代表取締役社長 早坂様、執行役員 沖代様

【会社概要】

会社名	キオクシア株式会社
代表者	代表取締役社長 早坂 伸夫
本社所在地	東京都港区芝浦 3-1-21 田町ステーションタワーS
事業内容	半導体メモリ及び関連製品の開発・製造・販売事業及びその関連
従業者数	単独 約 9,500 名、連結 約 13,600 名 (2021年3月31日現在)

【申請事業計画の概要】

内容	横浜テクノロジーキャンパスにおける技術開発新棟（仮称）の建設
所在地	横浜市栄区笠間 2 丁目
建物概要	地上 6 階建て
延床面積	約 40,000 m ²
計画予定	2021 年秋着工、2023 年夏竣工
申請額	約 138 億円

※申請事業計画の審査は今後実施予定

<投資計画の詳細：キオクシア株式会社ホームページ>

<https://about.kioxia.com/ja-jp/news/2021/20210513-1.html>



お問合せ先

経済局企業誘致・立地課長 黒澤 龍一 Tel 045-671-3894

* 本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。